# 科学研究費助成事業

### 研究成果報告書



平成 26 年 6月 9日現在

| 機関番号: 1 1 3 0 1   |
|---|
| 研究種目: 基盤研究(A)   |
| 研究期間: 2011~2013   |
| 課題番号: 2 3 2 4 6 1 1 8   |
| 研究課題名(和文)広帯域・高周波ナノ複相構造薄膜の創製と複機能融合物性の解明  |
|   |
| 研究課題名(英文)Synthesis of nano-composite films for wide and high frequency range and clarificatio<br>n of their multi-functional properties |
| 研究代表者<br>増本 博(MASUMOTO, HIROSHI)  |
| 東北大学・国際高等研究教育機構・教授  |
| 研究者番号:5 0 2 0 9 4 5 9   |
| 交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 37,200,000 円 、(間接経費) 11,160,000 円  |

研究成果の概要(和文):次期デバイスのさらなる高集積化、高機能複合化、低エネルギー・省エネルギー化へ向けて 、広帯域・高周波で応答する磁気-誘電等の複合機能性を有する、新たな薄膜材料の開発が必要とされてきている。 本研究では、新しく開発したスパッタリング法を用いた複合構造制御により、セラミックスマトリクス中に磁性ナノ金 属粒子が分散した構造を持つナノ複相構造薄膜を作製した。全方向で使用することが可能な高周波軟磁性材料、優れた 耐熱性をもつ広帯域・高周波電磁波シールド薄膜材料、磁場により高周波帯域で電気特性が変化する複機能融合材料な どを創製した。

研究成果の概要(英文): Development of the multi-functional film materials such as magnetic-dielectric for wide and high frequency range has been required for a high integration, high functionality and energy saving of the next-generation device.

In this research, the nano-composite films which have magnetic nano-particles dispersed in the ceramic mat rix were prepared by two kinds of sputtering method. High frequency soft magnetic materials which can be u sed in all direction, electromagnetic-wave shielding films with heat-resistance at wide and high frequency range, and magnetoelectric multi-functional material at high frequency of GHz-range were synthesized.

研究分野:工学

科研費の分科・細目:材料工学

キーワード: ナノ複相構造 複機能融合物性 磁性体 誘電体 薄膜

#### 1.研究開始当初の背景

近年のユビキタスネットワークの急速な 実現化に伴い、GHz 帯以上の高周波ワイヤレ ス通信技術に必要なアンテナ、フィルタなど の電子デバイス材料や電磁波シールド材料 などの周辺技術の開発が急務となっている。 現在、数 GHz を越える高周波帯デバイスは主 に誘電体を用いた研究が盛んに行われてい るが、それに対応する電磁波シールド材の開 発が立ち遅れている。また現在、各電子デバ イスがそれぞれ異なる周波帯域を利用する ため、対応するアンテナやシールド材が複数 必要となる。このため、電子デバイスの統合 化、小型化、省エネ化の観点から、広帯域対 応の高周波材料の開発が、情報通信、自動制 御などの分野において求められている。

申請者らは、現在、異なる複数の機能(磁 性、誘電性)を組み合わせた「磁性体-誘電 体ナノ複相構造薄膜材料」の創製研究を行っ ている。「ナノ複相構造薄膜」とは、スパッ タ装置により磁性金属と誘電セラミックス を同時成膜し、誘電体中にナノ磁性粒子が自 己生成により分散したナノ複相膜である。分 散するナノ磁性粒子の粒径、組成、体積分率、 界面構造などを制御することにより、GHz 帯 域での高軟磁気特性や、高TMR 特性など、優 れた機能性を有する新規な薄膜材料を見出 した。

本基盤研究 A では、これらの研究から新た に着想した「積層成膜自己拡散法」および「積 層成膜 in-situ 拡散法」の2つの方式を適宜 用いて、広帯域かつ高周波で有用な複機能融 合物性を示す新規な磁性体 - 強誘電体ナノ 複相構造薄膜を創製し、その複機能融合物性 の発現とメカニズムの解明を行う。また、広 い周波帯域で対応可能とするナノ複相構造 薄膜の作製にも挑戦する。磁気 - 誘電特性の 測定では、低電界および低磁界中で精密測定 が可能な、新たに考案した電気磁気接合素子 を使用する。

2.研究の目的

本申請では、新たに発案する「積層成膜自 己拡散法」および「積層成膜 in-situ 拡散法」 の2つの結晶化方式で磁性体 - 強誘電体ナ ノ複相構造薄膜の創製し、その複機能融合物 性を明らかにする。各種磁性金属および強誘 電セラミックスの組み合わせや、ナノ構造制 御、自己組織化制御等の成膜条件と組成・構 造などの解析および磁気的・電気的諸特性と の相関を明らかにする。複機能物性測定には、 低電界や低磁界中で磁気・誘電特性が測定可 能な、電気磁気接合素子を作製し、新たに設 計・製作する高周波複機能物性評価装置を用 いて、高周波磁気・誘電複機能融合物性を評 価し、その複機能融合物性のメカニズムの解 明を行うことを目的とした。 研究の手順は以下の通りである。

(1) ナノ複相構造をとりうる磁性体 - 強誘 電体の最適な組み合わせの探査

磁性体 - 強誘電体の探査の結果、大きく分類して研究成果以下に述べる4つの組み合わせ((1)Co-AIN、(2)Co-TiN、(3)CoPd-SrTiO<sub>3</sub>、(4)(Co-Ti-O)/(Bi-Ti-O))を提案し、研究を行った。

(2) 積層成膜自己拡散法または積層成膜 in-situ 拡散法による複相構造薄膜の作製

積層成膜自己拡散法または積層成膜 in-situ拡散法にはいずれもRFマグネトロン スパッタガンが複数設置されており、所定の 条件・雰囲気中で、石英および Si 基板上に 成膜した。ターゲットにはTiN, AIN, SrTiO<sub>3</sub>, TiO<sub>2</sub>, Bi<sub>4</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub>, Co, Pd を用いた。自己拡散 法では、得られた膜を抵抗線加熱炉により所 定の条件で熱処理を行った。in-situ 拡散法 では、成膜時に加熱を行った。

(3) 得られた膜の構造・磁気・誘電特性の評価

膜の構造および微細組織は X 線回折法 (XRD)および高分解能透過型電子顕微鏡 (TEM)を用いて観察した。組成分析は、エネ ルギー分散 X 線分光法(EDS)および X 線光 電子分光法(XPS)で行った。

磁気特性は振動型磁力計(VSM)で、透磁 率(µ)はシールド・ループ・コイル法で評価 した。電気比抵抗は4 探針法により求めた。 電磁波ノイズ吸収特性は50Wに終端したマイ クロストリップライン(MSL,W=3mmxL=75mm) を用い、ネットワークアナライザーを用いて 伝送線路から発生する電磁波ノイズの抑制 量を評価した。

(4) 電気磁気接合素子の作製と高周波磁 気・誘電特性の評価

高周波磁気・誘電特性評価素子は、リソグ ラフィおよびリフトオフプロセスによりパ ターニングを施し、端子間 250 µmの高周波 プローブを用いて、0.1-10 GHzの周波数帯域 におけるインピーダンスの外部磁界依存性 を測定した。

4.研究成果 (1) Co-AIN ナノ複相薄膜の構造と誘電・磁

気特性

マトリックスが、酸化物系のナノグラニュ ラー薄膜は研究例の多さから、組成によって 現れる特性が明らかにされつつあるが、窒化 物系は研究例が少なく、特性と組成の関係は ほとんど知られていない。本テーマでは、優 れた電気絶縁性と誘電特性を有する AIN と、 グラニュラー化で軟磁性膜が得られる Co を 組み合わせることで、誘電および磁気の両特 性が期待される広い組成領域での Co-AI-N 複 合薄膜を作製し、その構造と誘電・磁気特性

3.研究の方法



図1 Co-AIN 膜の組成と諸特性

を調べた。

図1に作製した Co-AI-N 膜の構造および特 性をまとめた。AIN 膜は hcp-AIN の結晶構造 であった。Co 17 at.%以上で AIN と Co の混 合相、47~80 at.%で膜はナノグラニュラー を呈し、Coの粒径は Co 量の増加と共に 3~ 6nm に<br />
増加した。<br />
Co 6 at.%<br />
未満の<br />
領域で<br />
誘電 膜が得られ、Co 量の増加にともない誘電率 )は4.2から19.1に増加し、誘電損失(D) も 0.03 から 0.17 へ増加した。Co 6~22 at.% の領域で超常磁性膜が得られ、47~80 at.% の領域で飽和磁化(Bs)=5.8~12(kG)を有し、 面内に等方である垂直磁化膜が得られた。さ らに膜は高周波軟磁気特性を示し透磁率 (μ) 10~68 を示した。図 2 に Co<sub>80</sub>AI<sub>14</sub>N<sub>6</sub>膜の µの周波数依存性を示す。
膜は GHz 帯域まで μ =48 を維持し、共鳴周波数 (f,) 1.2GHz 付 近に鋭いピークを持つ理想的な高周波軟磁 気特性を示した。

従来、このような優れた高周波軟磁気特性 は、従来一軸異方性を有する膜でのみ報告さ れており、本研究によって初めて垂直磁化膜 の高周波軟磁気特性を見出すことに成功し た。



### (2) Co-TiN 系ナノヘテロ複相構造薄膜に よる耐熱性を有する軟磁気材料の開発

高い熱的安定性を示すナノ複相膜を得る ために、マトリックス材には高い熱的安定性 が期待される TiN を選んだ。高周波デバイス では μとその f,が極めて重要になる。大きな



 $f_r$ を得るためには、材料の異方性磁界 ( $H_k$ )の大きさを制御出来ることが必須となる。その制御方法として本テーマでは、膜に 1k0eの静磁界中で150~600 の温度範囲で1時間 保持する熱処理を施し系統的に検討した。

VSM で  $Co_{56}$ -(TiN)<sub>44</sub> 複相膜の磁気特性を調 べた。図3に600 で熱処理した結果を示す。 2500e の磁場での磁化の大きさは約8kG であ り、保磁力は容易磁化方向(青線) 困難磁 化方向(赤線)とも約40e、そして $H_k$ の大き さは290e であった。熱処理前後の結果(図4) を比べると、Co-TiN 複相膜のBと保磁力(Hc) は600 で熱処理してもほとんど変化が無く 安定である。Hcの温度変化が不変であること は、本系膜のTiN ナノ結晶マトリックスが、 600 の高温でもCo粒子の粒成長を抑制して いることを示唆している。

図5には成膜したままと静磁界中熱処理を 施した試料の µ-f 特性を示す。400 で熱処 理した Co<sub>0.56</sub>-(TiN)<sub>0.44</sub>膜の透磁率は約500 で



あり、熱処理無しの試料のそれと比較して大きい。このことは熱処理により、歪みが緩和したためと思われる。一方、熱処理温度の増加と共に f,は1から1.6GHz まで増大する。f,の増加は異方性磁界 Hkの増加によって拡大したものと思われる。

本研究成果は、高周波応用の観点から極め て有益であり、例えば、材料を随意の温度で 静磁界中熱処理することにより、広帯域・広 帯域の周波数帯で発生する EMI ノイズを抑制 する、最適な材料の提供が可能となる。

(3) Co-Pd-SrTiO<sub>3</sub>系ナノ複相薄膜の作製と 軟磁気特性

大きな誘電特性と強磁性とを併せ持つ材料 を得ることを目的に、耐酸化性が高く、大き な結晶磁気異方性を有しているため微粒子 になっても強磁性を維持する(強磁性の臨界 直径が小さい)CoPdと、結晶性が比較的安定 であり誘電率の大きな SrTiO<sub>3</sub> ターゲットを 用いて、 複合機能性を有するナノ複相 CoPd/SrTiO<sub>3</sub> 膜の合成を試みた。

図 6 に組成が Co<sub>53</sub>Pd<sub>19</sub>(Sr<sub>.10</sub>Ti<sub>.19</sub>O<sub>.75</sub>)<sub>28</sub>の膜表 面の超高分解能電子線顕微鏡写真を示す。膜 は 3-6nm の濃い粒状の結晶質物質と薄い網 状の非晶質物質からなるナノグラニュラー 構造っており、その格子間距離から粒子は CoPd、一方網状の非晶質物質は STO であると 推察される。



図 6 Co<sub>53</sub>Pd<sub>19</sub>(Sr<sub>.10</sub>Ti<sub>.19</sub>O<sub>.75</sub>)<sub>28</sub>の膜 表面の超高分解能 TEM 写真

Co-Pd-STO 膜の透磁率の周波数依存性を図 7 に示す。白抜きの は実測値、実線およ び破線は L.L.G.の運動方程式を用いた計算 結果である。透磁率µの絶対値は 20 とそれ ほど大きくないが、f,は観察されないため、 評価装置の測定限界周波数(3GHz)をはるか に超えている。そのため、L.L.G.の運動方程 式により f,を見積もると、得られた膜の f, は 8 GHz 付近に存在することがわかる。

このように比較的大きなµと高い f,を示 す軟磁性膜の報告はほとんど無く、例えば近 未来の高周波モバイル機器への磁性材料と して期待できる。 (4) (Co-Ti-0)/(Bi-Ti-0)積層薄膜の高周波 磁気インピーダンス効果

高周波(GHz)帯域における電気-磁気特性 の発現を目的として、Co系ナノ複相膜の積層 化を検討し、高周波磁気インピーダンス効果 の発現を明らかにした。具体的には、Coナノ 粒子が Ti-0 中に分散した軟磁性層と、 Bi-Ti-0 の誘電層の積層膜を作製し、0.1-10 GHz における誘電特性評価および高周波磁気 インピーダンス特性を調べた。

多層膜は、2元rfマグネトロンスパッタ装置を用いたタンデム法で作製した。基板の回転(切替)速度を制御することによって、層数(層厚)を1-240層(350-2 nm)の範囲で変化させた(Co-Ti-0)/(Bi-Ti-0)膜を作製した。ま



図7 Co-Pd-STO 膜の透磁率の周波数依

た、高周波電気磁気効果の測定を目的として、 図 8(a)に示す多層構造を有する新規高周波 MI 素子を考案した。図 8(b)より、ML は Co 系 グラニュラー磁性層、DL および IL は、それ ぞれ厚みの異なる誘電層であり、これらの多 層構造を Pt 電極で挟み電極間の垂直方向に 高周波電界が印加されるようになっている。



波 MI 素子の(a)外観および(b)電 極部の積層構造の模式図。

図9に9層Co-Ti-0層を挿入した(Co-Ti-0) /(Bi-Ti-0)膜の積層部の断面 TEM 像を示す。 膜の面直方向に直径 5 nm 以下の、微細な柱 状の集合組織が観察される。これらの多層膜 は、一般的な高周波軟磁性膜の様な一軸磁気 異方性を持たず、面内に磁気的等方性を有す る。すなわち、本研究で作製した膜は使用方 向を選ばず、面内全方向へ使用可能である。 これらの膜は、作製時の誘導磁気異方性の付 与が必要ないことからも工業的応用性に優 れている。



図 9 Co-Ti-0 を 9 層挿入した (Co-Ti-0)/(Bi-Ti-0)多層膜の 断面 TEM 像。

図 10 に、9 層の(Co-Ti-0)/(Bi-Ti-0)膜の 面内方向に 0-334 0e の H<sub>ex</sub>を印加した時の、 (a) µ ' および(b) µ "の周波数依存性を示 す。直流の H<sub>ex</sub> は、図中に示すように、測定 時の交流磁界(H<sub>rf</sub>)に対して面内平行に印加 した。膜のµは Hex の増加とともに減少し、 3.7 GHz 付近に現れていた自然磁気共鳴のピ ークも消失した。一方、9 層の(Co-Ti-0) /(Bi-Ti-0)膜について GHz 帯の高周波磁気イ ンピーダンス特性を調べた。図 11 に、導電 成分を表す(a) コンダクタンス(G) および静 電容量成分を表す(b) サセプタンス(B)の周 波数依存性を示す。G および B は周波数の増 加とともに増加し、抵抗成分が減少した。H<sub>ex</sub>



層膜に、面内に外部磁界(H<sub>ex</sub>)を印加し た時の μ の周波数依存性。 のない状態(黒線)からは、膜の f, である 3.7 GHz 付近にステップ状の G および B の減少が 観察された。このステップは、H<sub>ex</sub>の増加とと もになだらかになり、96 0e の H<sub>ex</sub>ではほぼ消 失した。この高周波磁気インピーダンス効果 の最大値は約 12%であった。G および B のス テップの消失は図 10 のµの自然共鳴のピー ク消失と対応している。



膜に、面内に外部磁界(H<sub>ex</sub>)を印加した 時の Y (=G + jB)の周波数依存性。

## (5) 総括

本研究においては、東日本大震災によるダ メージにより、一時期研究が遂行できないと いう深刻な事態も経験したが、全方向で使用 することが可能な小型の高周波アンテナ、広 帯域・高周波電磁波シールドとして有用な高 耐熱性薄膜材料や、磁気共鳴を介して電気磁 気効果が発現する、複機能融合物性材料の創 製という当初の目標を達成することができ た。これらの材料に関する基盤的研究は申請 者ら独自の成果であり、次世代情報電子機器 の発展を支える基盤的材料として今後も重 要な研究課題になると考える。

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計12件)

H. Kijima, Y. Zhang, <u>N. Kobayashi</u>, <u>S.</u> <u>Ohnuma</u>, P. Muralt, N. Setter and <u>H.</u> <u>Masumoto</u>, High frequency magnetoimpedance effects in (Co-Ti-O)/Bi-Ti-O multilayer films., 2013 Joint UFFC, EFTF and PFM Symposium, 査読有, (2013),56-58, DOI: 10.1109/ISAF.2013.6748674

A. Watazu and <u>H. Masumoto</u>,  $Ba_2NaNb_5O_{15}$ thin film formed by electron cyclotron resonance plasma sputtering, Journal of Physics, 査読有, 417(2013)12066, DOI: 10.1088/1742-6596/417/1/012066

Y. Zhang, H. Kijima, <u>N. Kobayashi, S.</u> <u>Ohnuma, H. Masumoto</u>, Structure and high-frequency soft-magnetic properties of Co-TiN nano-composite films, J. Ceram. Soc. Jpn., 査読有, 121(2013)36-39, DOI: 10. 2109/jcersj2.121.36

H. Kijima, <u>Y. Zhang</u>, <u>N. Kobayashi</u>, <u>S.</u> <u>Ohnuma</u>, P. Muralt, N. Setter, and <u>H.</u> <u>Masumoto</u>, (Co-Ti-O)/Bi-Ti-O Multilayer Films with High-Frequency Electromagnetic Response., Jpn. J. Appl. Phys., 査読有, 52 (2013) 09KA14-1-09KA14-4, DOI: 10.7567/ JJAP.52.09KA14

H. Kijima, <u>S. Ohnuma</u> and <u>H. Masumoto</u>, Effect of perpendicular magnetic anisotropy on the high frequency soft magnetic properties of Co-Al-N films, J. Magn. Soc. Jpn., 査読有, 36(2012)287-292, DOI:10.3379/msjmag.1206R007

H. Kijima, <u>Y. Zhang, N. Kobayashi, S.</u> <u>Ohnuma</u> and <u>H. Masumoto</u>, High Frequency Soft Magnetic Performance on Magnetically Isotropic Co-AI-N Films in External Bias Field, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 查 読有, 48(2012)2910-2913, DOI: 10.1109/ TMAG. 2012.2196683

<u>S. Ohnuma</u> and <u>H. Masumoto</u>, Properties and Structure of High Frequency Soft Magnetic Nano-composite Films., 査読有, J. of Magnetics, 16(2011)403-407, DOI: 10.4283/ JMAG.2011.16.4.403

Y. Zhang, S. Ohnuma and H. Masumoto, Soft Magnetic Co-(TiN) Composite Films Realized within a Wide-Range of Cobalt Content., 査読有, IEEE Trans. on Magnetics, 47(2011)3795-3798, DOI: 10.1109/TMAG.2011. 2156763

H. Kijima, <u>S. Ohnuma</u> and <u>H. Masumoto</u>, High-Frequency Soft Magnetic Properties of Isotropic Co-AI-N Films., IEEE Trans. on Magnetics, 査読有, 47(2011)3928-3931, DOI: 10.1109/TMAG.2011.2154302

[学会発表](計41件)

<u>増本博</u>,加藤茉奈弥,<u>張亦文</u>,<u>小林伸聖</u>, <u>大沼繁弘</u>, MgF<sub>2</sub>-Co 系ナノ複相薄膜の作製と 磁気特性,日本セラミックス協会 2014 年会 2014/03/17,東京.

木嶌英恵,<u>張亦文</u>,<u>小林伸聖</u>,<u>大沼繁弘</u>, P. Muralt,N. Setter,<u>増本博</u>,(Co,CoTiO<sub>2</sub>) -Bi<sub>4</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub> 積層膜の高周波磁気インピーダン ス効果,第 37 回 日本磁気学会学術講演会, 2013/09/03,北海道.

H. Kijima, <u>S. Ohnuma</u>, <u>Y. Zhang</u>, <u>N. Kobayashi</u>, P. Muralt, N. Setter and <u>H. Masumoto</u>, High frequency magnetoimpedance effects in (Co-Ti-O)/Bi-Ti-O multilayer films, 2013 Joint UFFC, EFTF and PFM Symposium, ISAF-SPC10, 2013/07/21, チェコ Prague.

木嶌英恵,<u>張亦文</u>,<u>小林伸聖</u>,<u>大沼繁弘</u>, Paul Muralt, Nava Setter,<u>増本博</u>, CoTiO<sub>2</sub>-Bi<sub>4</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub> 積層膜の高周波電気-磁気応答性, 強誘電体応用会議,2013/05/22,京都.

H. Kijima, <u>Y. Zhang</u>, <u>N. Kobayashi</u>, <u>S.</u> <u>Ohnuma</u> and <u>H. Masumoto</u>, High Frequency Soft Magnetic Performance on Magnetically Isotropic Co-Al-N Films in External Bias Field, IEEE International Magnetics Conference, 2012/05/07, カナダ Vancouver.

<u>H. Masumoto</u>, Integrated functional thin films by interface control, Progress and Innovation of Smart Materials and Related Technology 2012, 2012/04/24, Hirosaki.

<u>Y. Zhang</u>, H. Kijima, <u>N. Kobayashi</u>, <u>S.</u> <u>Ohnuma</u>, <u>H. Masumoto</u>, Effects of magnetic field annealing on ferromagnetic resonance frequency of Co-TiN nanocomposite films, Progress and Innovation of Smart Materials and Related Technology 2012, 2012/04/24, Hirosaki.

<u>小林信聖</u>,岩佐忠義,石田今朝男,<u>横井</u> <u>敦史,大沼繁弘,増本博</u>,FeCo-MgF ナノ粒 子複合膜の誘電特性,日本金属学会 2012 年 春期大会,2012/03/29,横浜.

6.研究組織
 (1)研究代表者
 増本 博(MASUMOTO, HIROSHI)
 東北大学・国際高等研究教育機構・教授
 研究者番号:50209459

(2)研究分担者

牧野 彰宏(MAKINO, AKIHIRO)
東北大学・金属材料研究所・教授
研究者番号: 30315642
小林 伸聖(KOBAYASHI, NOBUKIYO)
公益財団法人電磁材料研究所・電磁気材料グ
ループ・主席研究員
研究者番号: 70205475
横井 敦史(YOKOI, ATSUSHI)
公益財団法人電磁材料研究所・電磁気材料グ
ループ・研究員
研究者番号: 60513760
張 亦文(ZHANG, YEWEN)
東北大学・学際科学国際高等研究センター・
教育研究支援者
研究者番号: 30279959

(3)連携研究者
 大沼 繁弘(OHNUMA, SHIGEHIRO)
 公益財団法人電磁材料研究所・素形材開発グループ・主席研究員
 研究者番号:50142633